

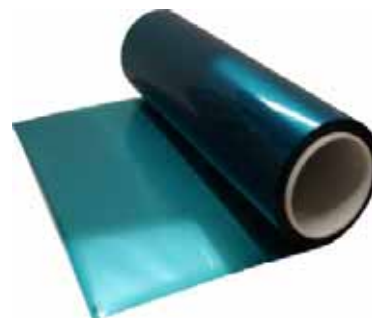
ケミカルミリング用ドライフィルムレジスト

Dry Film Photoresist for Chemical Milling

MS9050

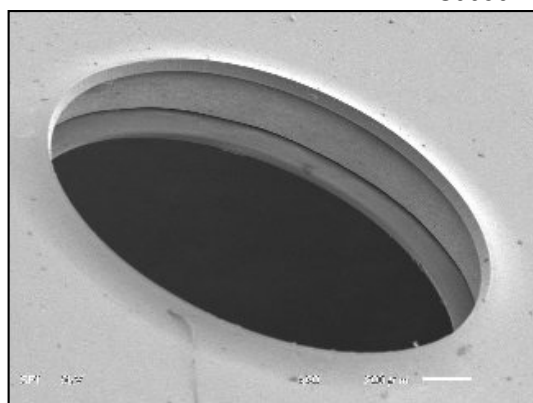
ケミカルミリング用の厚膜タイプアルカリ現像型ネガ型ドライフィルムフォトレジストです。
Negative-working Alkaline Developable Thick Dry Film Resist for Chemical Milling.

- 金属基材への優れた密着性 Excellent Adhesion to Metal Substrate
 SUSをはじめとする金属への密着性と、エッチング液への耐性に優れています。
- 優れた剥離性能 Excellent Resist-Stripping Performance
 エッチング処理後の剥離時に、通常のドライフィルムレジストとは異なりレジストが細片になって剥離します。また、剥離片が剥離液に溶解するため、レジスト剥離片のワークへの付着がありません。
 剥離片除去の手間を軽減し、後工程の障害発生の可能性を低減します。



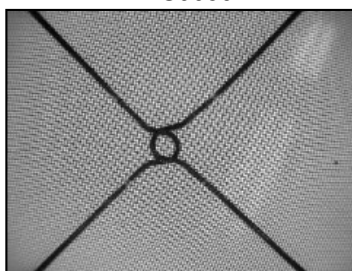
型式 Type	レジスト厚み Resist Thickness
MS9050	50 μm

Example of Chemical Milling
 MS9050

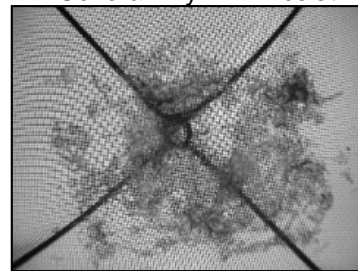


0.2mmt SUS 430H 1.0mm
 after Etching / before Resist Stripping

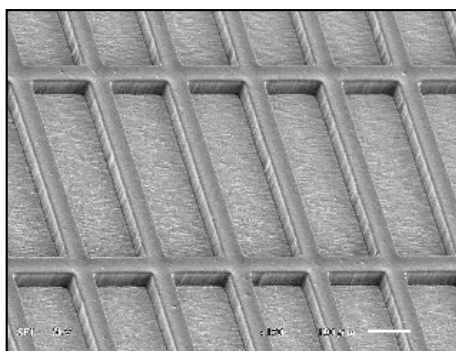
Residue after Filtration of Resist Stripper (50mesh)
 MS9050 General Dry Film Resist



No Residue



Resist Pattern



Line Width=50 μm